

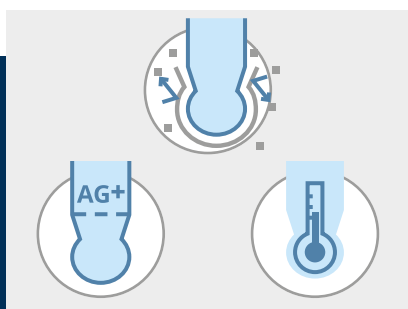
SE571

低维护 pH 传感器，适合于化工和涂装车间内要求苛刻的过程应用



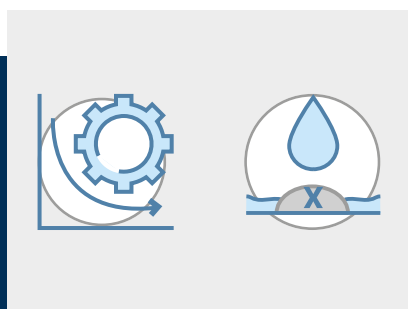
可在极端离子强度下测量，例如在盐卤和强氧化性含酸或含碱的介质中

采用特殊结构设计，即使在高压下也能在苛刻的受污染介质中进行 pH 测量。参比系统通过 PTFE 隔膜环与测量介质接触，该隔膜堵塞风险极低。带银离子阱的特殊筒式参比元件可防止参比系统中毒；储盐罐可防止浸析。该传感器采用 Knick 开发的升级版技术 Memosens II，适用于更高的环境温度。



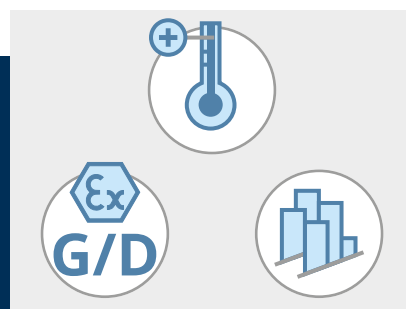
可靠的测量技术

- PTFE 隔膜环，不堵塞
- 银离子阱和储盐罐
- 内置温度探头



结构和材料

- 低维护，不用补充电解质
- 可选规格：不含油漆润湿干扰物质（不含 LABS）



Memosens II by Knick

- 环境温度高达 100 °C
- 气体和粉尘防爆认证
- 在带有图形显示屏的变送器上利用负荷矩阵和统计数据进行分析

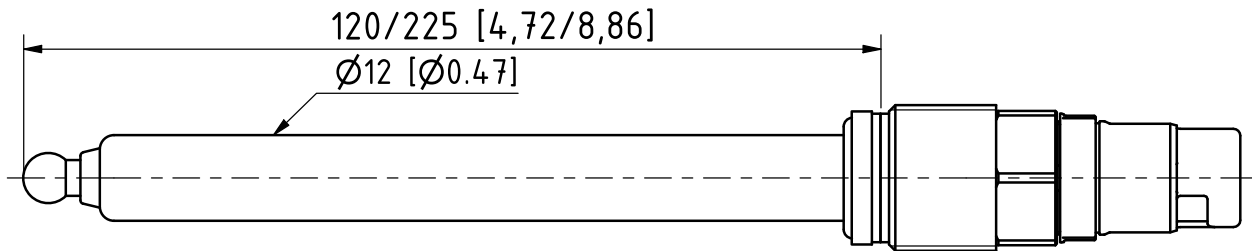
技术参数（摘录）

摘自操作说明书。详细信息 → knick-international.com

测量范围	
pH	0...14
过程温度	-5...130 °C (23...266 °F)
过程压力	0...12 bar (0...174 psi)
温度探头	NTC 30 kΩ
与介质接触的材料	
柄	玻璃
隔膜	PTFE 环
电解质	带 KCl 存储环的凝胶电解质
传感器尖端	Alpha 玻璃
参比系统	Ag/AgCl 带银离子阱
过程接口	PG 13.5
紧固扭矩	1...3 Nm
电气连接	Memosens 插接头
尺寸	参见尺寸图

尺寸图

提示: 所有尺寸单位均为毫米[英寸]。



Knick
Elektronische Messgeräte
GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22, 14163 Berlin
德国

电话: +49 30 80191-0

传真: +49 30 80191-200

info@knick.de • www.knick-international.com

保留变更权利。